

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成20年2月28日 (2008.2.28)

【公表番号】特表2003-523364(P2003-523364A)

【公表日】平成15年8月5日 (2003.8.5)

【出願番号】特願2001-561027(P2001-561027)

【国際特許分類】

C 0 7 K 5/09 (2006.01)

B 0 1 J 31/24 (2006.01)

C 0 7 C 255/60 (2006.01)

C 0 7 C 257/18 (2006.01)

C 0 7 K 1/02 (2006.01)

C 0 7 K 5/065 (2006.01)

C 0 7 K 5/068 (2006.01)

A 6 1 K 38/00 (2006.01)

A 6 1 P 7/02 (2006.01)

C 0 7 B 53/00 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【 F I 】

C 0 7 K 5/09

B 0 1 J 31/24 Z

C 0 7 C 255/60

C 0 7 C 257/18

C 0 7 K 1/02

C 0 7 K 5/065

C 0 7 K 5/068

A 6 1 K 37/02

A 6 1 P 7/02

C 0 7 B 53/00 B

C 0 7 B 61/00 3 0 0

C 0 7 M 7:00

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月10日 (2008.1.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 6 4 】

上記の手順を使用して、4 回のさらに別の不斉水素化を実施した [ バッチサイズ 8.0 kg ( 2 5 . 9 7 モル ) - 1 0 . 3 kg ( 3 3 . 4 4 モル ) ; 水素圧 2 - 1 0 バール ; 温度 4 0 ; 水素化時間 4 ~ 6 時間 ; 生成物含量 9 8 . 0 ~ 9 9 . 8 % ( H P L C ) ; 水素化溶液中の粗生成物のエナンチオマー純度 6 2 . 0 ~ 8 4 . 5 % e e の S 異性体 ( G C ) ] 。